17p-A14-1

オープニング： シンポジウム開催にあたって

Opening talk: The aim of this symposium

オルガノ　矢野 大作

Organo Corp.　Daisaku Yano

E-mail: yano-d@organo.co.jp

本シンポジウム「界面ナノ電子化学： 半導体ウェットプロセスの最前線」は界面ナノ電子化学研究会が企画するもので、今回は特に半導体ウェットプロセスの最先端技術について学術界および産業界それぞれから情報を持ち寄り、次世代の技術開発へつなげる場を形成する目的で開催する。

界面ナノ電子化学研究会は他の研究会と異なり、参加者の９５％が産業界という特殊な研究会である。これまで経験的に行われてきた半導体表面の洗浄・エッチングといったウェットプロセスを、界面ナノ電子化学として学問的に捉え、学術に基づいたプロセス開発を行うことにより、新たな処理・加工技術を創出することを目的として活動を行っている。

近年、日本の半導体産業衰退を指摘する声が多く聞かれるが、しかし現在も、半導体製造には欠かせないウェットプロセス技術において日本は世界のリーダーである。その強みは経験に基づくデータの蓄積にある。そのため暗黙知が多く、技術をさらに強化するためには理論的な解明が必要とされる。本研究会は一昨年および昨年の秋季講演会においてシンポジウムを開催し、企業研究者のみらず、大学等研究機関からの参加者も集めることができ、産業界のみの集会では実現出来なかった意見交換を行うことができた。このようにシンポジウムによって暗黙知が共鳴し、学術的解明が進行すれば、これからも日本のウェットプロセス技術が世界をリードし続けるはずである。企業研究者と学術界の研究者が討論する場の提供は重要であり、本シンポジウムもそのような場を提供したい。

今回は半導体ウェットプロセスの最先端技術および動向に焦点を当てた講演を行って頂き、産業界に蓄積されたデータと、学術界で生み出された最先端技術とが融合する場を提供することを目的として企画している。

© 2014 年　応用物理学会